# TNO透明導電膜の導入による色素増感太陽電池の作用電極界面の最適化

Reduction of the interface resistance in dye-sensitized solar cell with TNO transparent conductive film

 $^{\circ}$ 遠藤 剛志 $^{1}$ 、小野 理恵子 $^{1}$ 、奥谷 昌之 $^{12}$ 、岩城 諒 $^{1}$ 、竹村 秀一郎 $^{1}$ 、中尾 祥一郎 $^{3}$ 、岡崎 壮平 $^{3}$ 、 坂井 延寿 $^{3}$ 、山田 直臣 $^{3}$ 、一杉 太郎 $^{4}$ 、長谷川 哲也 $^{5}$ (1.静岡大院工、2.静岡大グリーン研、3.神奈川技術アカデミー、4.東北大 WPI-AIMR、5.東大院理)

°Takeshi Endo<sup>1</sup>, Rieko Ono<sup>1</sup>, Masayuki Okuya<sup>2</sup>, Ryo Iwaki<sup>1</sup>, Shuichiro Takemura<sup>1</sup>, Shoichiro Nakao<sup>3</sup>, Souhei Okazaki<sup>3</sup>, Enju Sakai<sup>3</sup>, Naoomi Yamada<sup>3</sup>, Taro Hitosugi<sup>4</sup>, and Tetsuya Hasegawa<sup>5</sup> (1. Grad. School Eng., Shizuoka Univ., 2. Res. Ins. Green Sci. and Tech., Shizuoka Univ., 3. KAST, 4. Tohoku Univ., 5. Tokyo Univ.)

## E-mail tcmokuy@shizuoka.ac.jp

#### 1. 背景

色素増感太陽電池 (DSSC) において、透明導電膜にはF ドープ  $SnO_2$  (FTO) を用いるのが一般的であるが、本研究ではNb ドープ  $TiO_2$  (TNO) を導入する。TNO 透明導電膜の導入により、従来の多孔質  $TiO_2$ /FTO ヘテロ接合 (FTO セル) に対し、多孔質  $TiO_2$ /TNO ホモ接合 (TNO セル) が形成され、これによる界面抵抗の低減により太陽電池特性の向上が期待できる $^{l)}$ 。今回は、バッファー層や多孔質  $TiO_2$ 層の膜厚を最適化することで、内部抵抗の低減を試み、これによる DSSC セルの高効率化について報告する。

## 2. 方法

マグネトロンスパッタ法により、ガラス基板上にアモルファス TNO 膜を作成した。さらにこの膜の結晶化および低抵抗化を目的に、水素雰囲気下で 500 °C、2 時間の還元アニールを行った。次に、この TNO 透明導電膜に緻密な TiO<sub>2</sub> バッファー層、多孔質 TiO<sub>2</sub> 層を順に SPD 法で積層した。さらに、この 電極を Alminum sec-butoxide 水溶液、または  $Mg(OAc)_2$  水溶液に浸漬・乾燥後、水素雰囲気下で 500 °C、30 分の再アニールを行い、多孔質  $TiO_2$  層に対してアルミナコーティング、またはマグネシアコーティングを行った。最後に、この電極に N719 色素を吸着させ、作用極とした。DSSC セルは、 $I^-/I_3^-$ 電解液を作用極と白金電極で挟み、完成させた。

### 3. 結果

Fig.1 にアルミナ、またはマグネシアコーティング を施した TNO セル (TNO シート抵抗 62.0 Ω/sq) と FTO セル (FTO シート抵抗 8.5  $\Omega/sq$ ) の *I-V* 曲線を 示す。TNO セルにおいて、電圧に対する電流密度 の減衰が緩やかな右下がりを示し、TNO 膜のシー ト抵抗が FTO 膜のそれに比べ大きいことを反映し ている。Table 1 にアルミナ、またはマグネシアコー ティングを施した TNO セルと FTO セルの電池パラ メータを示す。全般的に、アルミナコーティングで は  $I_{SC}$  が上昇、マグネシアコーティングでは  $V_{OC}$  が 上昇する傾向が観測された。さらに、FTO セルと TNO セルを比較すると、アルミナコーティングを 施した FTO セルの  $I_{SC}$  は 11.9 mA/cm<sup>2</sup> であったが、 TNO セルでのそれは 7.8 mA/cm<sup>2</sup> となった。これは TNO 膜のシート抵抗が FTO 膜のそれと比べ約 7倍 高いためである。その結果、TNO セルの変換効率 は最大 3.2 %に達したが、FTO セルの 5.6 %に及ばな かった。しかし、電気化学インピーダンスにおいて、 TNO セルにおける多孔質 TiO2/TCO 界面抵抗が FTO セルのそれ比べ低いことが観測されており、 TNOのシート抵抗をFTOと同等にすることにより、 将来的に TNO セルの高効率化が可能であると考え ている。



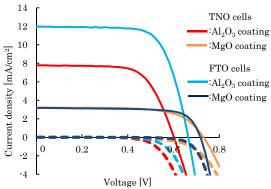


Fig.1 FV curve of DSSCs with TNO and FTO, in which porous  ${\rm TiO_2}$  layers ware coated with thin  ${\rm Al_2O_3}$  or MgO layer.

Table 1 Photovoltaic parameter of DSSCs with TNO and FTO, in which porous TiO<sub>2</sub> layers ware coated with thin Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> or MgO layer.

	TNO		FTO	
Sheet resistance $[\Omega/\text{sq}]$	62.0		8.5	
Coating	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MgO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MgO
$I_{\rm SC}[{\rm mA/cm}^2]$	7.8	3.2	11.9	3.1
$V_{\rm OC}[{ m V}]$	0.61	0.73	0.66	0.71
<i>FF</i> [-]	0.68	0.68	0.71	0.75
$\eta$ [%]	3.2	1.6	5.6	1.7